研究

FILE COPY

反射光の干渉による凹面形状測定*

Profile Measurement of a Concave Surface Using the Interference Fringe of Reflected Light

Tetsuo KUMAZAWA, Tatsuji SAKAMOTO and Shigeru SHIDA

This paper describes a simple method whereby a concave surface is irradiated with coherent light and the resulting interference fringes yield information on the concave surface. This method can be applied to a surface which satisfies the following conditions; (1) the concave face has a mirror surface; (2) the profile of the face is expressed by a mathematical function with a point of inflection. In this interferometry, multi-light waves reflected from the concave surface interfere and make fringes wherever the reflected light propagates. Interference fringe pattern is clear even in the range of high fringe orders. Photographs of the fringe patterns for a uniformly loaded thin silicon plate clamped at the edge are shown experimentally. The experimental and the theoretical values of the maximum optical path difference show good agreement. This simple method can be applied to obtain accurate information on concave surfaces.

Key words: interferometer, interference fringe, coherent light, profile, contour map, concave.

1. 緒

半導体製品, OA 機器などの性能安定化, 信頼性向上 にとってシリコン、ガラス、金属などを素材とする部品 の加工後に表面形状の測定、検査を行うことが不可欠で ある. 形状測定は測定精度がよいこと, 被測定物に接触 しないで測定できることが要求される場合が多い、この 要求を満たす方法としてサブミクロンの測定が可能な光 学的手法が優れており、ニュートン環を形成する方法, 二光東干渉法1),液浸法2)などが用いられている。しか しながら、これらの方法は干渉じまを形成させるために 被測定物の取付はが容易でないこと、測定、位置合わせ に時間がかかることなど必ずしも便利な方法であるとは 言い難い.

落者らは被測定物表面が凹面状をなし、この表面があ る特殊な条件を満たす場合に凹面にコヒーレントな光 (レーザ光など)を単に照射するという従来の光学的方 法に比べて簡単な方法で凹面形状に関する情報が得られ ることを見い出した. その原理は傾斜の異なる二つの平 面から反射された光が相互に干渉して干渉じまを形成す るフレネルの二枚鏡3)の原理に似ており、凹面の曲率が 異なる2か所から反射された光が互いに干渉して生じる 干渉じまを測定するものである. 本報ではこの方法にお ける干渉じま形成の原理、数値計算例と実測結果等につ いて述べる.

*** (株)日立製作所

2. 干渉じまの形成

2.1 凹面から反射された光線の軌跡

凹面の一例として周辺固定の薄肉円板(以下ダイヤフ ラムと言う)が横方向から等分布荷重をらけて変形した 曲面を図1に示す、円板表面は鏡面とする、円板の変形 量 W(x) は一般に式(1)で表される4).

$$W(x) = \frac{P}{64D} \{a^4 - (a^2 - x^2)^2\}$$
 (1)

ここに、P: 分布荷重, a: 半径, W: 変位量, D: 板の 曲げ剛性 $(D=\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, E:$ 縫弾性係数,h: 板厚, ν :

上記凹面に光線を当て、反射された光線の軌跡を以下 に順次求める. 図2に示す z-x 座標系において z 軸に平 行な入射光が凹面と交わる点を (z_0,x_0) とする。交点 (zo, xo) で凹面に法線を立てる、法線と入射光とのなす 角度 $\epsilon \theta$ とする。角度 θ が非常に小さいところでは

$$\frac{\partial W(x_0)}{\partial x} = \tan \theta \cong \theta \tag{2}$$

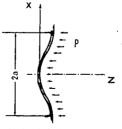


Fig. 1 Uniformly loaded circular plate clamped at the edge

Fig. 3

と基す。 期(12) ことな 表され

Phá 🖭 置气, 追 式出

とボム 火工 射光から 面から で等間. ときつ が A ・1 0) から へ移動し 198

原稿受付 昭和58年6月2日,昭和57年度精機学会春 季大会学術講演会(昭和57年3月22日)にて発表。

正 会 員 (株)日立製作所(土浦市神立町 502)

Copyright material not to be further reproduced without permission of the copyright owner.



Photocopie fournie par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique Conseil national de recherches Ottawa Canada K1A 0S2

reflected e fringes Interferie range e fringe on plate nentally, es of the id agreeplied to irfaces, e fringe, cave.

ダイヤフ 変形した 板の変形

(1) **D**: 板の

D: 板の 板厚, v:

跡を以下 **z**軸に平 る. 交点 とのなす では

(2)

ped at

生 2 号

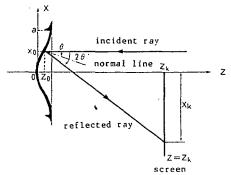


Fig. 2 Coordinate system of light locus

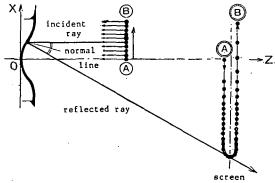


Fig. 3 Locus of light reflected from the concave surface

と表すことができる。四表面は鏡面であるから反射の法 則に従い入射光と反射光のなす角度は 20 となる。この ことを考慮して式(2)を用いると反射光の軌跡は式(3)で 表される。

$$\frac{x - z_0}{2 \cdot \frac{\partial W(x_0)}{\partial x}} = -(z - z_0)$$
 (3)

凹面の中心から z_k 離れた位置に x 軸に 平行 な観察面を置く. 観察面に到達する反射光の x 方向位置 x_k は式(1), 式(3) から

$$x_{k} = -\frac{P}{8D}(a^{2} - x_{0}^{2})x_{0}z_{k} + \frac{P}{8D}(a^{2} - x_{0}^{2})x_{0}z_{0} + x_{0}$$
(4)

と求められる.

式(4)を用いて入射光の照射位置 xo を変えた場合に反射光が観察面上で変化する様子を検討する。観察面は凹面から遠く離れているものとする。凹面の中央から縁まで等間隔に 40 本の光線で z 軸に平行に照射する。このときの反射光位置 x4 の計算結果を図 3 に示す。照射光が ②→③と移動したとき,反射光は観察面上で②(x=0)から負の方向へ移動し,ある点で反転して正の方向へ移動し,③の位置に戻る。緑を照射する z 軸に平行な

光線は反射してz軸に平行に戻る。この位置が③である。ここで、③→⑥の変化を理解しやすくするため光線の移動の様子を図3のように表現したが、実際には $z=z_4$ 軸上、すなわち一直線上を住復する。なお、 x_4 が最小値をとる反射光線は凹面を表す関数W(x)の変曲点 $(x_0=a/\sqrt{3})$ から反射された光線である。

以上の結果から凹面の異なる二つの場所から反射された光線が同じ xx 値をとる場合があることがわかった。このことは異なる箇所から反射された光路長の異なる光線が互いに重なり合い干渉じまが形成されることを示している。したがって、一光束で凹部全面を照明した場合には ②→③の間では光は一様に照明されるため反射光も連続して生じ干渉も連続して生じると考えられる。

照射光としてここでは平行光をとりあけたが、平行光 でなくともレンズを通った収束光など規則性のある照射 光であれば同様の干渉が生じる.

2.2 反射光の干渉

凹面から反射された光の干渉は多数の光波が重なり合った多波干渉状態になっていると考えられる。この多波 干渉状態を検討する。

一般に光波は式(5)のように複素表示される.

$$U_m = A \exp i(\omega t + \Delta_m) \tag{5}$$

ただし、 U_m : 光波、A: 振幅、 ω : 角速度、t: 時間、 A_m : 位相(添字mはm番目を意味する).

多数の光波の重ね合わせは式(6)と表される.

$$\sum_{m} U_{m} = A \exp i\omega t \left(\sum_{m} \cos \Delta_{m} + i \sum_{m} \sin \Delta_{m} \right)$$
 (6)

このとき強度 [は式(7)となる.

$$I = |\sum_{m} U_{m}|^{2} = A^{2} \{ (\sum_{m} \cos \Delta_{m})^{2} + (\sum_{m} \sin \Delta_{m})^{2} \}$$

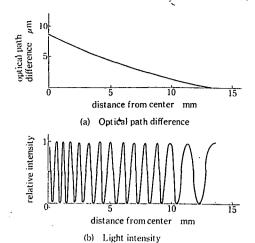
$$= A^{2} \sum_{m,m'} \cos(\Delta_{m} - \Delta_{m'})$$
(7)

四面から反射されて観察面上の任意の点に集まる光波は凹面上の異なる2点から反射された光波であった。解析上は凹面を理想的な鏡面としたが、実際には凹面は一部粗面も含んでいる。このような性質の凹面を考えると観察面上の任意の点に集まる光波は凹面上の異なる2点ではなく、2点およびその近傍から反射された光波であるといえる。そこで議論している干渉を異なる2点およびその近傍から反射された光波の干渉とすると、光波相互の光路差には2種類の光路差が含まれる。一つは異なる2点あるいは2点近傍から反射された光の干渉が起こる場合の光路差であり、その値は一定値となる。この値をるとする。他方は同一点近傍から反射された光波が相互に干渉するときの光路差であり、この光路差はほぼ0に等しい。したがって、光路差ると0から生じる位相差

Copyright material not to be further reproduced without permission of the copyright owner.



Photocopie fournie par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique Conseil national de recherches Ottawa Canada K1A 0S2



は一定値(この値を 4 とする)および 0 となる。このような位相状態の光強度は式 (7) より

Fig. 4

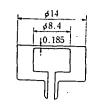
$$I = A^2 \sum_{m,m'} \cos (\mathcal{A}_m - \mathcal{A}_{m'}) \cong A^2 (k_1 + k_2 \cos \mathcal{A})$$

となる。ただし、 k_1, k_2 : 定数、 $d=2\pi\delta/\lambda$ 、 λ : 波長、したがって、明るさ変化は \cos 曲線で表され、光路差 δ の大きい高次のしま次数のところでもビジビリティがよいことがわかる。

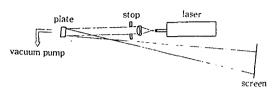
3. しま分布の計算と観察結果

3.1 しま分布の計算例

干渉じま分布の計算に用いた諸量は凹面を形成するダ イヤフラムの直径 8.4 mm, 板厚 0.185 mm, 縦弾件係 数 1.47×105 MPa, ポアソン比 0.2, 外圧力 0.098 MPa である. 凹面を照射する光線は 2軸に平行であり、そ の数は200とした。入射光は平面波と考えると光線相互 間の初期位相差は0である。観察位置 za は 4.0 m で x 軸に平行な面上である。この観察面上の任意箇所に集ま る光線(5本)は干渉するとして平均光路差を求めた。 光線数は最少2本あれば光路差は算出できるが、光線数 を5本とすることによりばらつきを低減させた。また光 路差は滑らかに変化することから最小二乗法で処理し た. 得られた光路差及びその光路差から式(8)を用いて 明るさの変化を求めた計算結果が図4である。光路差は 反射光が当たる領域の縁で最小であり、 縁から中心に向 かうに従い増大する。この光路差の変化に伴って光路差 から求まる相対的な光強度の変化、すなわち干渉じまの 間隔は中心に向かうほど狭くなることがわかる。なお、 しま次数は光路差が0の最外環のしまから中心に向かっ て1次,2次,…であり、最大しま次数は14.9次であっ



(a) Schematic diagram of a thin plate



(b) System for observing interference fringe

Fig. 5

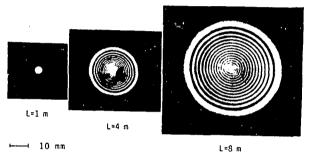


Fig. 6 Photograph of fringe pattern L: Distance from concave plate to screen

た.

3.2 干渉じまの観察結果

凹面を形成するため試作したシリコン製ダイヤフラムを有する中空体の断面を図5(a)に示す。このダイヤフラムの寸法は直径8.4 mm,板厚0.185 mmである。ダイヤフラムの装面は研磨し鏡面とした。この中空体の内部を真空ポンプで真空にし、外部から圧力0.098 MPaがかかるようにしてダイヤフラムを凹変形させた。圧力測定には水銀マノメータを用いた。光学系は1mW He-Neレーザを光源とし、コリメータで平行にしたビームをダイヤフラムに照明するという簡単な方法である(図5(b))。なお、ハーフミラーを用いてダイヤフラムに垂直に照明する方法もあるが、簡単な方法としてハーフミラーを使用しない方法を採用し測定した。干渉じまは紙スクリーン上に投影して観察した。

ダイヤフラム凹面から 1,4,8 m離れた観察面で記録した干渉じま写真を図6に示す。最外環のしまは明縞である。最外環のしまから中心に向かってしま次数は1次、2次、…となっており、しま次数が増してもコントラストがきわめてよい。干渉じまパターンの性質としてしま次数が増すにつれてしま問隔が減少することがわか

Fig

うおっかる はに値に

基式

1 .

. j. . .

トで、 光 ・ ・ ・

21 15

ادا: د

た。 干。 差を。

1.9

Copyright material not to be further reproduced without permission of the copyright owner.



Photocopie fournie par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique Conseil national de recherches Ottawa Canada K1A 0S2

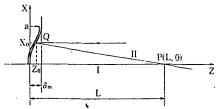


Fig. 7 Coordinate system of light locus used to calculate the max, optical path difference

る.このしまの性質は計算結果(図4)と一致する.なお、観察位置が4mの場合、最大しま次数は14.5であった.この値も計算結果とよく一致している. 観察位置が遠くなるにつれて干渉じまの太さが増す傾向がみられる.この理由は次のように考えられる.干渉じま環の径は観察位置が遠くなるほど増大する(図3参照).これに対し最大しま次数は観察位置が遠く離れるに従い一定値に収束する(4.1節参照).すなわち観察距離が増えるにつれて干渉じまが生じる領域が増すのに対し、その領域に生じるしま次数は限られる.したがって、1しま当たりの占める領域(しまの太さ)は増大することになる.

4. 干渉じまの性質

4.1 母大光路差

最大しま次数と凹面の変形量との関係を図7を用いて 検討する。最大しま次数から決まる最大光路差は凹面中 央から反射された光線 I と観察面上で交差する光線 II とから生じる。光線 I と光線 II の交点を P(L,0), 光線 II と凹面の交点を $Q(z_0,x_0)$, 凹面の最大変形量を δ_m とする。光線 II は P(L,0) を通ることから式(4)を用い

$$x_0^2 = a^2 - \frac{8D}{P(L - z_0)} \tag{9}$$

また式(1)より

$$\hat{\sigma}_m = \frac{P \cdot a^4}{64D}$$
, $z_0 = \hat{\sigma}_m - \frac{P}{64D}(a^2 - x_0^2)^2$ (10)

図7において $z=\delta_m$ を基準にして光路差 δ を求める。

光線 I の光路長: $\delta_1 = \delta_m + L$

光線 II の光路長: $\delta_{II} = \delta_m - z_0 + \sqrt{(L - z_0)^2 + x_0^2}$

光路差: δ=δ₁-δ₁₁

$$=L+z_0-\sqrt{(L-z_0)^2+x_0^2}$$

 z_0 は μ_m , L は m の大きさであるから $L-z_0\cong L$ と近似し、式 (ω) を用いると

$$\delta = 2z_0 - \frac{1}{2L} \left(a^2 - \frac{8D}{PL} \right) + \frac{1}{8L3} \left(a^2 - \frac{8D}{PL} \right)^2 \tag{11}$$

となる.

干渉じまの計算(3.1節)と同じ条件の下に最大光路 差を式(1)から求めた、図8に観察位置 Lを変えたとき

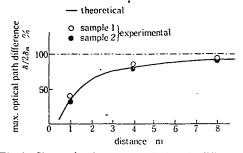


Fig. 8 Change in the max, optical path difference according to the distance of the screen from the concave surface $\delta/2\delta_m$; Max. optical path difference/two times the

max. deflection

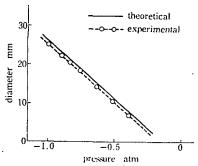


Fig. 9 Negative pressure versus diameter of 1st order fringe ring

の最大変位量の 2 倍に対する最大光路差の比($\delta/2\delta_m$)を示す。干渉じまから求めた実測値と計算結果とはよく合っている。また観察位置が遠くなるほど最大光路差は凹面の最大変位量 δ_m の 2 倍に近づく。例えば観察位置 4 m のとき最大変位量の 2 倍に対する最大光路差の比($\delta/2\delta_m$) は 80.6% であるが,8 m の場合には 90.1% となる。この比を用いると最大しま次数から変形量を知ることができる。この場合観察位置が凹面から離れたところ、 $\delta/2\delta_m$ 値で言えば 100% に近いところで最大しま次数を読みとるとばらつきが増大せず変形量測定の精度が上がる。

4.2 圧力と干渉じまの変化

圧力を変化させるとダイヤフラムの凹面状態が変わって凹面から反射された光の干渉で生じるしまの大きさや、しま次数が変化する。干渉じまが圧力によって変化する様子を調べるため図5に示したダイヤフラムを用いて干渉じまを形成した。干渉じまの観察は凹面から4m離れた位置で行った。干渉じまパターンの中から第1次明縞の径をとりあげ圧力依存性を調べた結果を図9に示す。圧力が0近傍では光が集中し、光の強度が著しく上がるため除外し、干渉じま環が大きいところで測定した。実測値は一直線上にのっており圧力としま環の径は直線

面で記録 は明編は なコント

ヤフラム

)ダイヤフ

ある: グ

空体の内

098 MPa

:た. 圧力

mW He-

たビーム

ある(図

ラムに垂

ハーフミ

じまは紙

n plate

nge

質として とがわか

多 2 号

Copyright material not to be further reproduced without permission of the copyright owner.



Photocopie fournie par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique Conseil national de recherches Ottawa Canada K1A 0S2

関係にあることを示している。計算結果も同様に直線関係にある。しかし実測値と計算値とを表す両直線の間には差異がある。この差異はダイヤフラム材料定数の算定誤差によるものと考えられる。定数の算定を厳密に行うことで実測値は容易に一致するものであろう。

4.3 干渉じまに関する検討

本法で提案した反射光干渉法で干渉じまを形成する場合の制約条件,干渉じまの性質,応用等について若干補足検討を行う.

1) 凹面形状, サイズ等

前述のように本干渉法で干渉じまが形成される必須条件は凹面を表す関数が変曲点を有する凹面に限定されることである。一般に物体表面が平坦であり、1 か所が加圧されてくばんだ場合にくばみ中央が平坦である場合には干渉じまは形成される。例えば、周囲が固定された板がたわむ場合をとりあげると、板が円板でなくとも三角形、四角形、…など任意の形状が上記条件を満足し干渉じまが形成される。しかし、凹変形状態を関数表示することは一般に困難であり、干渉じまの形成を計算できる形状は特殊な場合に限られる。

照射光が反射屈折の法則に従い規則正しい反射光線を 生じる面をなしていない場合には規則性のない干渉が起 こるか、全く干渉が生じなくなる.このため本干渉法を 適用する場合にはコーティング、研磨などにより被測定 物表面をかなり良い鏡面状態にする必要がある.

2) 照射光

本提案の光干渉法は反射光が干渉できる状態にあってはじめて成り立つものである。したがって、光源としてはコヒーレントな光を出すレーザを使用することになる。干渉じまを形成させる位置が凹面から離れるほど干渉じまの形成される領域は拡大され観察が容易となる。また凹面から離れるほど変形量の測定精度が上がる。

光線の照射方法として平行光照明を本解析では採用した。平行光線のほかにレンズを通した収束光など規則性のある光を用いてもよい。場合によっては照明方法として収束光を用いるとかえって干渉じまパターンが形成される領域が縮小し、データ処理しやすい場合もある。

3) 本干渉法の適用

負圧力を変化させて凹面形状を変えると形成される干 港じま環の径は圧力に比例して変わることを示した。こ の結果から干渉じまの径の変化をとらえることにより非 接触で圧力の大きさを知ることができる。また、圧力の はかに式(1)から明らかなように干渉じま形成に関係す る弾性係数、板厚があり、これらの検出が可能である。

以上、被測定物体の形状に凹面をとりあげて解析した。凹面を対象とした場合、中央に凹面物体を設置し第

1 象限で入射光を照射すると、反射された光線は第4象限で干渉する(図3参照)。一方、凸面の場合に凸面を表す関数が変曲点をもつならば凹面の場合と同様な干渉じまが形成される。ただし、凸面の場合、第1象限で照明したとき干渉は第1象限で生じる。凸面の場合についても本干渉法が適用できる。

被測定物表面が前記議論したような形状をしている場合には表面から反射されて光が相互に干渉してしまが形成される。このような場合として二つの平面が任意の角度で向かい合っているフレネルの二枚鏡のほかに変曲点をもつ凹面があることを明らかにした。変曲点をもつ凹面は測定対象が限られているが、干渉じまは反射光の通る任意の場所で干渉じまが形成され、しかもしまのビジビリティが大変よい。このため本法は凹面形状情報を得るために一つの有力な光学手法であると思われる。

5. 結 論

凹面の形状に関する情報を知る新しい光学干渉法を提案し、干渉じまの生成、しまの特徴を検討した。その結果の概要は次の通りである。

- (1) 凹面が鏡面であり、凹面を表す関数が変曲点を有するならば凹面に平行光を照射するのみで反射光が相互に干渉し、しまが形成される.
- (2) 干渉じまは反射光の伝播する任意の場所で形成される。干渉じま群の最外縁のしまは明縞であり、中心に向かってしま次数が増す。しま次数の増大に伴いしま間隔は減少する性質がある。
- (3) 最大しま次数から凹面の最大変位量が推定できるが、その精度はしまの観察位置が凹面から離れるほど上昇する.
- (4) 干渉じまに影響を及ぼす因子の一つである圧力を 変えると圧力変化に比例して干渉じま環の径、例え ば第1次のしま環の径が変化する。

終わりに、本研究の測定に関してご援助いただいた日 立製作所、松岡祥隆、御法川斉氏らに深謝します。

参 考 文 献

- B. P. Hildebrand and K. A. Haines: Multiple-wavelength and Multiple Source Holography Applied to Contour Generation, J. Opt. Soc. Amer., 57, (1967) 155.
- N. Shiotake, T. Tsuruta and Y. Itoh: Holographic Generation of Contour Map of Diffusely Reflecting Surface by Using Immersion Method, Jap. J. Appl. Phys., 7,8, (1968) 904.
- 3) 例えば, 久保田 広: 波動光学, 岩波書店 (1971).
- 4) 例えば、S. Timoshenko: Theory of Plate and Shell, McGraw-Hill, New York, N.Y., (1959).

研_

On : Star

The ing n previous plicat with on bottester indicat

- 要証要ば生本証しタれ用発し「しっとし業」を報して20のい生でさて、10年の10年では10年の10年では10年の10年に10年の10年に10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年の10年

1:1:

特系。

に評価

用です

Copyright material not to be further reproduced without permission of the copyright owner.



Photocopie fournie par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique Conseil national de recherches Ottawa Canada K1A 0S2